

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成23年9月1日(2011.9.1)

【公表番号】特表2010-533571(P2010-533571A)

【公表日】平成22年10月28日(2010.10.28)

【年通号数】公開・登録公報2010-043

【出願番号】特願2010-516292(P2010-516292)

【国際特許分類】

B 01 D	46/10	(2006.01)
B 01 D	71/36	(2006.01)
B 01 D	39/14	(2006.01)
B 01 D	39/16	(2006.01)
B 01 D	53/04	(2006.01)
B 01 D	53/02	(2006.01)
B 01 D	53/14	(2006.01)

【F I】

B 01 D	46/10	A
B 01 D	71/36	
B 01 D	39/14	L
B 01 D	39/14	Z
B 01 D	39/14	N
B 01 D	39/16	C
B 01 D	53/04	C
B 01 D	53/02	B
B 01 D	53/14	A

【手続補正書】

【提出日】平成23年7月12日(2011.7.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

フィルターセンブリを汚染物抑制媒体で充填する方法であって、

a) 内部空洞と、前記内部空洞に連結する少なくとも1つの充填ポートと、開口部を少なくとも部分的に覆っているフィルタ媒体を有する前記開口部と、を有するハウジングを供給する工程と、

b) 汚染物抑制媒体を供給する工程と、

c) 空気が前記充填ポートを通って流れるように、前記フィルタ媒体を吸引して部分的に真空にして前記内部空洞内を負圧にする工程と、

d) 前記汚染物抑制媒体を前記内部空洞内に吸引する工程と、
を有することを特徴とする方法。

【請求項2】

前記フィルタ媒体は、ePTFE(拡張ポリテトラフルオロエチレン)を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。

【請求項3】

前記汚染物抑制媒体は、活性炭、シリカゲル、およびそれらの組合せを含む吸着性物質

であることを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】

前記汚染物抑制媒体を前記内部空洞に吸引後に前記充填ポートをシールする工程をさらに含むことを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

【請求項 5】

前記少なくとも 1 つの充填ポートは、約 0.5 ミリメートル未満の直径を持つことを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

【請求項 6】

前記フィルターセンブリは、電子機器の封入容器中に挿入するように構成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

【請求項 7】

汚染物抑制媒体の供給装置であって、
汚染物抑制媒体を保持する保持ユニットと、
前記汚染物抑制媒体を密封空間に充填するアセンブリと、
前記汚染物抑制媒体の前記密封空間への移動を容易にするように空気流を前記密封空間に生成するデバイスと、
を有することを特徴とする供給装置。

【請求項 8】

前記密封空間に充填される充填量を規制する手段をさらに有することを特徴とする請求項 7 に記載の供給装置。

【請求項 9】

圧縮空気または同等物によって前記密封空間中への前記汚染物抑制媒体の充填を容易にする手段をさらに含むことを特徴とする請求項 7 に記載の供給装置。

【請求項 10】

前記充填ポートを通過する空気流は、前記フィルタ媒体を部分的に真空にすることによって生成されることを特徴とする請求項 7 に記載の供給装置。